

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成17年5月19日(2005.5.19)

【公開番号】特開2000-351917(P2000-351917A)

【公開日】平成12年12月19日(2000.12.19)

【出願番号】特願平11-162912

【国際特許分類第7版】

C 09 D 1/00

C 03 C 17/25

C 03 C 17/30

C 09 D 7/12

C 09 D 183/02

【F I】

C 09 D 1/00

C 03 C 17/25 A

C 03 C 17/30 A

C 09 D 7/12 Z

C 09 D 183/02

【手続補正書】

【提出日】平成16年7月14日(2004.7.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

C<sub>o</sub>、C<sub>r</sub>、M<sub>n</sub>、F<sub>e</sub>、N<sub>i</sub>、C<sub>u</sub>、Z<sub>n</sub>およびランタノイド(La～Lu)からなる群から選ばれる1種以上の金属の塩と、Siのアルコキシドまたはその部分加水分解物と、樹脂とを含む塗布液であって、塗布液中の前記金属の塩の全金属とSiとの総量に対するSiの原子比が0.28以上である酸化物膜形成用塗布液。

【請求項2】

金属の塩がCuの塩とMnの塩とからなる請求項1に記載の酸化物膜形成用塗布液。

【請求項3】

金属の塩がCuの塩とMnの塩とCrの塩とからなる請求項1に記載の酸化物膜形成用塗布液。

【請求項4】

金属の塩が硝酸塩である請求項1、2または3に記載の酸化物膜形成用塗布液。

【請求項5】

化学式HO(CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O)<sub>n</sub>H(ただし<sub>n</sub>は2～8の整数)で表されるエチレングリコールオリゴマーの1種以上を含む請求項1～4のいずれかに記載の酸化物膜形成用塗布液。

【請求項6】

エチレングリコールオリゴマーが、ジエチレングリコール、トリエチレングリコールおよびテトラエチレングリコールからなる群から選ばれる1種以上である請求項5に記載の酸化物膜形成用塗布液。

【請求項7】

塗布液中の前記金属の塩の全金属に対するエチレングリコールオリゴマーのモル比が0

. 3 以下である請求項5または6に記載の酸化物膜形成用塗布液。

【請求項 8】

樹脂が水溶性樹脂である請求項 1 ~ 7のいずれかに記載の酸化物膜形成用塗布液。

【請求項 9】

請求項 1 ~ 8のいずれかに記載の酸化物膜形成用塗布液を基体上に塗布し、300℃以上の温度で焼成する酸化物膜形成方法。

【請求項 10】

基体上に請求項9に記載の酸化物膜形成方法により酸化物膜が形成されてなる酸化物膜付き基体。